

용융염 기반의 화학기상증착법을 이용한 원자층 두께의 고품질 MoS₂ 합성

고재권^{1,2*} · 육연지^{1*} · 임시현¹ · 주현규¹ · 김현호^{1,2†}

¹금오공과대학교 신소재공학부

²금오공과대학교 에너지공학융합전공

*본 논문의 공동 주저자

(2021년 03월 31일 접수, 2021년 05월 01일 수정, 2021년 05월 04일 채택)

Molten-Salt-Assisted Chemical Vapor Deposition for Growth of Atomically Thin High-Quality MoS₂ Monolayer

Jae Kwon Ko^{1,2*}, Yeon Ji Yuk^{1*}, Si Heon Lim¹, Hyeon-Gyu Ju¹, Hyun Ho Kim^{1,2†}

¹School of Materials Science and Engineering, Kumoh National Institute of Technology, Gumi 39177, Korea

²Department of Energy Engineering Convergence, Kumoh National Institute of Technology, Gumi 39177, Korea

(Received March 31, 2021, Revised May 01, 2021; Accepted May 04, 2021)

내용: 지난 2021년 6월호에 투고된 ‘Molten-Salt-Assisted Chemical Vapor Deposition for Growth of Atomically Thin High-Quality MoS₂ Monolayer’ 김현호, *Journal of Adhesion and interface*, <http://dx.doi.org/10.17702/jai.2018.19.2.84>에 대하여 이와 같이 정정합니다.

저자분께서 작성해주신 원고의 저자 중 ‘고재권, 육연지’님은 공동 주저자로, 기존 기사에 두 저자분을 교신저자로 기재하여 학술지가 제작되었습니다. 올바른 주저자 표기 및 교신저자는 이 정정기사에 표시된 것과 같습니다.

†Corresponding author: Hyun Ho Kim (kimhh@kumoh.ac.kr)

한국 접착 및 계면학회는 이러한 오류와 결과적으로 저자와 독자분들께 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.